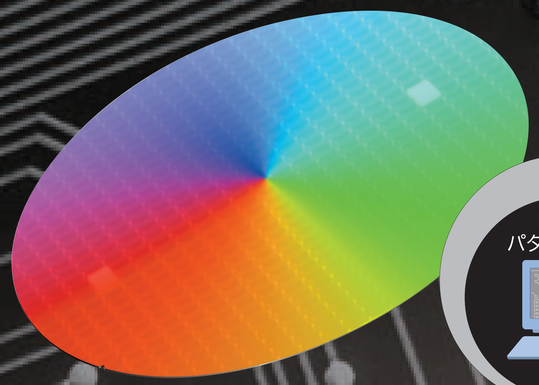
HORIBA
Semiconductor

半導体プロセスの理想形を トータルに創造する 先進の分析システム





●レティクル/マスク
異物検査装置
PD Xpadion

露光工程



●差圧式
マスフローモジュール
CRITERION D700



●サーマル式
マスフローモジュール
SEC-Z700S



●キャパシタンス
マノメータ
VG-500



●液体材料
気化システム
LF-F/MV-2000



●プラズマ
発光モニタ
EV 2.0 Series



●ガスモニタ
IR-400

流体計測・制御 ／ 真空計測・分析（ドライプロセス）

●工業用pH計
排水分析

●自動薄膜計測装置●紫外可視エリプソメータ
計測／エッチング制御／薄膜分析

マスク製造工程

回路・パターン設計

フォトマスク作成

ウエハ製造工程

インゴットの引き上げ

インゴットの切断

ウエハの研磨

ウエハ表面を酸化

前工程

ウエハ表面にパターン形成

エッチング

酸化・拡散・CVD・イオン注入

電極形成

ウエハ検査

平坦化（CMP）

フォトレジスト塗布

後工程

ウエハのダイシング

チップのマウンティング

ワイヤーボンディング

モールド

トリム＆フォーム

半導体完成

マーキング

製品検査信頼性試験

バーンイン（温度電圧試験）

●レーザ回折／散乱式粒子径分布測定装置
●ナノ粒子解析装置

CMPプロセス

素材解析

●PL測定装置
●カソードルミネッセンス測定システム

クリーンルーム内雰囲気監視

●クリーンルーム内雰囲気ガスモニタ

純水プロセス（ウェットプロセス）

●高感度シリカモニタ　●溶存酸素モニタ
●シリカ分析装置　●超純水用比抵抗計

素材解析（微粒子分析、欠陥解析）

●全自動薄膜検査装置
●顕微レーザラマン分光測定装置
●グロー放電発光分析装置　●X線分析顕微鏡



●全自動フォトルミネッセンス
マッピング装置
PLATO-300

薬液プロセス（ウェットプロセス）



●光ファイバ式
非接触薬液濃度モニタ
CS-900F



●光ファイバ式
熱リン酸濃度モニタ
CS-620F



●内部液循環式
溶存酸素モニタ
HD-960LR

HORIBA

株式会社堀場製作所　〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 TEL(075)-313-8121(代) http://www.horiba.co.jp

株式会社堀場エステック　〒601-8116 京都市 南区上鳥羽鉾立町11-5 TEL(075)-693-2312 http://www.horiba-stec.jp